

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第2部門第1区分

【発行日】平成18年5月25日(2006.5.25)

【公表番号】特表2002-511336(P2002-511336A)

【公表日】平成14年4月16日(2002.4.16)

【出願番号】特願2000-543233(P2000-543233)

【国際特許分類】

B 01 J	23/04	(2006.01)
B 01 J	35/10	(2006.01)
C 07 C	51/09	(2006.01)
C 07 C	51/347	(2006.01)
C 07 C	51/353	(2006.01)
C 07 C	57/04	(2006.01)
C 07 C	67/343	(2006.01)
C 07 C	69/54	(2006.01)

【F I】

B 01 J	23/04	Z
B 01 J	35/10	3 0 1 G
C 07 C	51/09	
C 07 C	51/347	
C 07 C	51/353	
C 07 C	57/04	
C 07 C	67/343	
C 07 C	69/54	Z

【手続補正書】

【提出日】平成18年3月27日(2006.3.27)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】請求項15

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項15】 調節剤元素の化合物をシリカとともに共ゲル化もしくは共沈澱すること、または調節剤元素のハロゲン化物とハロゲン化ケイ素の混合物を加水分解することを含む請求項1もしくは2記載の触媒の製造方法。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】請求項20

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項20】 プロピオン酸メチルを、セシウム1~10wt%（金属として表わされて）を含有する多孔質の高表面積シリカを含有する触媒の存在下に、ホルムアルデヒドおよびメタノールと反応させることを含み、該触媒はジコニウム化合物を触媒がシリカ100モルあたりジルコニウム元素を合計0.25~2グラム原子含有するような量で、含み、該ジルコニウム化合物は該シリカの細孔内に分散されている、ことを含むメタクリル酸メチルの製造方法。

【手続補正3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】請求項21

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項 21】触媒のための調節剤としてのホウ素の使用であり、該触媒はアルカリ金属 1 ~ 10 wt% (金属として表わされて) を含有する多孔質の高表面シリカを、触媒がシリカ 100 モルあたりホウ素を合計 0.25 ~ 2 グラム原子含有するような量で、含み、ホウ素は該シリカの細孔に分散されており、そして触媒の表面積減少の速度を低下させるものである、ホウ素の使用。